

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

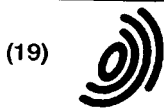
Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 979 992 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
16.02.2000 Patentblatt 2000/07

(51) Int. Cl.⁷: G01L 9/00

(21) Anmeldenummer: 99112978.4

(22) Anmeldetag: 05.07.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 11.08.1998 DE 19836341

(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

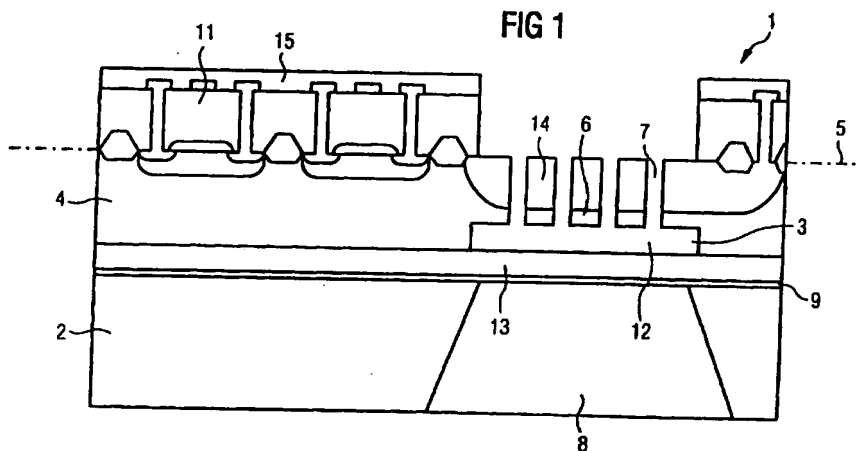
(72) Erfinder:

- Aigner, Robert, Dr.
81675 München (DE)
- Bever, Thomas, Dr.
81739 München (DE)
- Timme, Hans-Jörg, Dr.
85521 Ottobrunn (DE)

(54) Mikromechanischer Sensor

(57) Beschrieben ist ein mikromechanischer Sensor auf einem Halbleitersubstrat mit auf dem Chip integriertem elektronischen Schaltkreis umfassend einen Hohlraum, eine Membran, eine Gegenelektrode und Ventilationsöffnungen, welche das Volumen des Hohlraums mit der Umgebung verbinden, welcher dadurch gekennzeichnet ist, daß die Ventilationsöffnungen in

Richtung der Oberseite des Wafers angeordnet sind und die Gegenelektrode Bestandteil einer Beschichtungsebene ist, die über die gesamte Chipfläche reicht, so daß auf diese Beschichtungsebene eine elektronische Halbleiterschaltung in Halbleitertechnologie aufgebracht werden kann.



EP 0 979 992 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen mikromechanischen Sensor auf einem Halbleitersubstrat mit auf dem Chip integriertem elektronischen Schaltkreis umfassend einen Hohlraum, eine Membran, eine Gegenelektrode und Ventilationsöffnungen, welche das Volumen des Hohlraums mit der Umgebung verbinden.

[0002] Für bestimmte Anwendungen, wie Drucksensoren oder Mikrofone, sind stark miniaturisierte Sensoren erwünscht mit deren Hilfe beispielsweise Druckunterschiede bzw. Druckschwankungen oder Schallschwingungen gemessen werden können.

[0003] Ein mikromechanischer Sensor für Anwendungen in der Akustik ist in der US 5,146,435 beschrieben. Der beschriebene Sensor besteht aus einer beweglichen Membran und einer Stützstruktur aus einem Siliziumwafer. Oberhalb des Webwafers ist eine Gegenelektrode angeordnet, die über die Waferfläche hinausragt und einen Hohlraum zwischen Membran und Gegenelektrode bildet. Die Gegenelektrode weist auf der Oberseite Ventilationsöffnungen auf, die zum Zwecke des Luftaustausches des Hohlraums mit der Umgebung verbunden sind. Unterhalb der beweglichen Membran ist der Siliziumwafer entfernt, so daß das akustische Signal an die Membran herantreten kann. Das Prinzip, nach dem der mikromechanische Sensor arbeitet, basiert auf einer Volumenänderung des Hohlraums, welche eine Kapazitätsänderung des durch die Membran und die Gegenelektrode gebildeten Kondensators bewirkt. Zur Messung der Kapazität befinden sich auf der Oberseite des Wafers elektrische Kontakte. Eine Auswertelektronik auf dem Wafer ist nicht vorgesehen.

[0004] Die deutsche Patentanmeldung 196 48 424.3 beschreibt einen mikromechanischen Sensor, welcher für Druckmessungen und Schallmessungen verwendet werden kann. Der Sensor ist auf einem SOI-Substrat (Silicon Oxide Isolator) aufgebaut und umfaßt eine Membran aus polykristallinem Silizium, welche über einer Abstandsschicht auf der Substratunterlage angeordnet ist. Die Abstandsschicht und die polykristalline Membran bilden einen Hohlraum, wobei sich auf der gegenüberliegenden Seite der Membran eine Gegenelektrode im Bereich des Substrats befindet. Somit ist die Gegenelektrode unterhalb der Membran angeordnet. Die Membran befindet sich in Richtung der Oberseite des Chips. Zum Luftausgleich sind Ventilationsöffnungen vorhanden, die in Richtung der Unterseite des Substrats ausgerichtet sind. Die polykristalline Membran bildet gemeinsam mit den übrigen Ebenen eine Chipfläche, die nicht eben ist.

[0005] Ein Nachteil der vorstehend beschriebenen Konstruktion für einen mikromechanischen Sensor ist es, daß der Sensor nicht auf einfache Weise hergestellt werden kann. Aufgrund der gegenüber der Substratfläche beabstandeten angeordneten Membranfläche ist die Topologie des halbfertigen Sensors während der Fertigung nicht geeignet, um darauf auf einfache Weise eine

Halbleiterschaltung aufzubringen. Eine Fertigung der Schaltung mit einer geringen Anzahl von Prozeßschritten ist daher nicht möglich.

Ein weiterer Nachteil der vorstehenden Anordnung ist es, daß die Membran aus polykristallinem Silizium besteht. Polykristallines Silizium weist nicht befriedigende Eigenschaften hinsichtlich der mechanischen Festigkeit auf, was beispielsweise bei der Fertigung Probleme mit sich bringt. So muß das halbfertige Sensorelement wesentlich vorsichtiger gehandhabt werden, um Beschädigungen der empfindlichen Sensorfläche zu vermeiden. Weiterhin ergeben sich Nachteile bei der Fertigung von bekannten mikromechanischen Sensoren mit einer in Richtung der Oberseite ausgerichteter Membran. So kann es beispielsweise bei der Montage oder beim Sägen des Wafers zu Einbußen in der Produktqualität kommen.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines mikromechanischen Sensors, der die vorstehend beschriebenen Nachteile von bekannten Sensoren nicht aufweist.

[0007] Die Erfindung betrifft einen mikromechanischen Sensor nach Anspruch 1.

[0008] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen 2 und 3, sowie 5 bis 11.

[0009] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Sensors nach Anspruch 4.

[0010] Beschreibung der Figuren:

Figur 1 zeigt einen mikromechanischen Sensor gemäß der Erfindung, welcher auf einem SOI-Substrat hergestellt worden ist.

Figur 2 zeigt einen mikromechanischen Sensor, welcher auf einem herkömmlichen Siliziumsubstrat hergestellt worden ist.

[0011] Die Herstellung des mikromechanischen Sensors gemäß Figur 1 erfolgt in der Weise, daß zunächst auf ein SOI-Substrat Opferschicht, welche vorzugsweise aus Siliziumoxid besteht, aufgebracht wird, und im Anschluß daran eine epitaktische Schicht 4 aufwachsen gelassen wird. Die Dicke der Schicht 4 ist relativ viel größer als die Dicke der Schicht 3, so daß sich nach diesem Schritt eine ebene Fläche 5 ergibt. Ggf. ist es notwendig, daß diese Fläche zur Verbesserung der Glätte poliert wird. Im allgemeinen wächst die epitaktische Schicht 4 im Bereich des Wafers 2 einkristallin auf, im Bereich des Materials der Opferschicht entsteht polykristallines Silizium. Zur Verbesserung der Qualität der epitaktischen Schicht 4 kann vorzugsweise auf die Opferschicht 3 eine Seed-Schicht aufgebracht werden, welche beispielsweise aus polykristallinem Silizium bestehen kann. Im Anschluß daran werden auf übliche Weise Gräben 7 in die epitaktische Schicht 4 eingetätzt, so daß Kanäle entstehen, die bis zur Opferschicht 12 ragen. Diese Kanäle werden dann vorzugsweise mit

Siliziumoxid gefüllt. Im Anschluß daran kann als weiterbildendes Konstruktionsmerkmal auf herkömmliche Weise eine elektronische Halbleiterschaltung in Dünnschichttechnologie aufgebracht werden. Hierbei kann es sich beispielsweise um einen an sich bekannten CMOS, Bi-CMOS oder bipolaren Prozeß handeln. Danach wird die Rückseite des Substrats stromlos beispielsweise mit KOH oder TMAH geätzt, so daß eine Öffnung 8 entsteht. In einem weiteren Ätzschritt, welcher sich nach oder vor der Rückseitenätzung durchführen läßt, werden die Oxide in den Kanälen und in der Opferschicht entfernt. Hierdurch entsteht ein Hohlraum 12, welcher über Kanäle 7 mit der Umgebung verbunden ist. Die Kanäle 7 durchdringen daher vorzugsweise die Gegenelektrode 14. Die Membran 13, welche bei der Rückseitenätzung entsteht, ist so dünn ausgeführt, daß sie beispielsweise unter Einfluß einer Schallwelle zu Schwingungen angeregt werden kann. Die Dicke der Membran liegt vorzugsweise zwischen 0,2 µm und 1 µm. Es ist möglich die Membran 13 im Seitenbereich der Abstützung dünner auszuführen, so daß die Schwingung der Membran bereits bei kleineren Schallamplituden erfolgen kann. Vorzugsweise hat die Membran eine Gesamtlänge im Bereich von 100 µm bis 2000 µm.

Die Rückseitenätzung wird zweckmäßigerweise stromlos, insbesondere mit einer KOH-Ätzlösung, durchgeführt.

[0012] Zur Herstellung des mikromechanischen Sensors in Figur 2 wird ein gegenüber dem vorstehenden Verfahren abgewandelter Herstellungsweg beschrieben. Gemäß Verfahren zur Herstellung des mikromechanischen Sensors nach Figur 1 wird bei der rückseitigen Ätzung der Ätzprozeß durch eine Siliziumoxidschicht 9 abgestoppt. Bei Verwendung eines SOI-Wafers wird diese Schicht durch das eingesetzte Wafermaterial automatisch geliefert. Die Herstellung des Sensors in Figur 2 erfolgt ohne die Verwendung eines SOI-Substrats. Zunächst wird das Substrat vor dem Aufwachsen der Schichten 3 und 4 mit einer geeigneten Dotierung, welche beispielsweise bei einem p-Wafer eine n-Dotierung sein kann, versehen. Der dotierte Bereich 10 ist vorzugsweise räumlich begrenzt. Der dotierte Bereich dient als Ätzstopp bei der rückseitigen Ätzung des Hohlraums 8. Vorzugsweise kommen für die rückseitige Ätzung zwei Verfahren zur Anwendung:

a) Der Bereich 10 wird mit einem geeigneten Material, beispielsweise Bor, hochdotiert, insbesondere mit einer Dotierungskonzentration von mehr als 10^{19} cm^{-3} . Als Wafer wird ein n- oder p-Wafer eingesetzt. Die Ätzung des Hohlraums erfolgt entweder mit EDP (toxic), KOH, insbesondere in heiß konzentrierter Form oder mit TMAH.

b) Herstellung eines Bereichs 10 mit einer schwach p- oder n-leitenden Dotierung mit einer Dotierungskonzentration von insbesondere weniger als 10^{15} cm^{-3} . Als Wafer wird ein stark p- oder n-dotierter

Wafer eingesetzt, mit einer Dotierungskonzentration von insbesondere größer als 10^{18} cm^{-3} . Die Ätzung des Hohlraums erfolgt elektrochemisch mit HF oder KOH.

[0013] Die Entfernung der Opferschicht 3 erfolgt vorzugsweise durch Naßätzung.

[0014] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung des erfindungsgemäßen Sensors zur Herstellung von Drucksensoren, insbesondere Relativdrucksensoren, und Mikrofonen. Bei Sensoren für den Einsatz in Mikrofonen ergeben sich Vorteile, wenn die Membran in Richtung der Unterseite der Chipfläche angeordnet ist.

[0015] Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung ist, daß die Membran aus einkristallinem Material bestehen kann. Hierdurch ergibt sich eine verbesserte mechanische Beständigkeit im Vergleich zu Membranen aus polykristallinem Material. Gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur Herstellung von mikromechanischen Sensoren ist das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren auf vereinfachte Weise durchführbar. So kann beispielsweise auf die Herstellung von Zwischenschichten, wie sie beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung 196 48 424.3 beschrieben sind, verzichtet werden.

[0016] Das Verfahren der vorliegenden Erfindung bietet darüber hinaus den Vorteil einer ebenen Chipfläche. Beispielsweise bei der Herstellung von Schaltkreisen auf dem Chip des Sensors nach oder während der Herstellung der Sensorstruktur werden die Verfahrensschritte durch eine ebene Chipfläche vereinfacht.

Patentansprüche

1. Mikromechanischer Sensor (1) auf einem Halbleitersubstrat (2), mit auf dem Chip integriertem elektronischen Schaltkreis (11) umfassend einen Hohlraum (12), eine Membran (13), eine Gegenelektrode (14) und Ventilationsöffnungen (7), welche das Volumen des Hohlraums mit der Umgebung verbinden,

dadurch gekennzeichnet, daß

die Ventilationsöffnungen in Richtung der Oberseite des Wafers (15) ausgerichtet sind und die Gegenelektrode Bestandteil einer Beschichtungsebene (5) ist, die über die gesamte Chipfläche reicht, so daß auf diese Beschichtungsebene eine elektronische Halbleiter-Schaltung (11) in an sich bekannter Halbleiter-Technologie aufgebracht werden kann.

2. Mikromechanischer Sensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Membran aus einkristallinem Material besteht.

3. Sensor nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Gegenelektrode leitfähig ausgebildet oder mit einer leitfähigen Schicht versehen ist.

4. Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Sensors umfassend die Schritte:

a) Herstellung einer Opferschicht (3) auf einem Halbleiter-Substrat (2) in einem Bereich der Substratoberfläche, 5
 b) epitaktisches Aufwachsen lassen eines halbleitenden Materials in der Weise, daß eine ebene Schicht (5) entsteht, die den Bereich der Opferschicht überragt, wobei diese Schicht im Bereich der Opferschicht polykristallin aufwächst, 10
 c) ggf. Glätten dieser ebenen Schicht,
 d) Ätzen von Öffnungen (7) und Füllen der Öffnungen mit einem geeigneten Material, 15
 e) Entfernen des Materials in den Öffnungen und der Opferschicht und Rückseitenätzung des Wafers zur Freilegung der Membran und Erzeugung einer Sensor-Öffnung. 20

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
 das Substrat ein Wafer mit einer Oxid-Zwischenschicht (SOI) ist, wobei die Oxid-Zwischenschicht als Ätzstopp bei der Rückseitenätzung wirkt. 25

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
 das Stoppen der Rückseitenätzung durch geeignete Dotierung des Wafers erreicht wird. 30

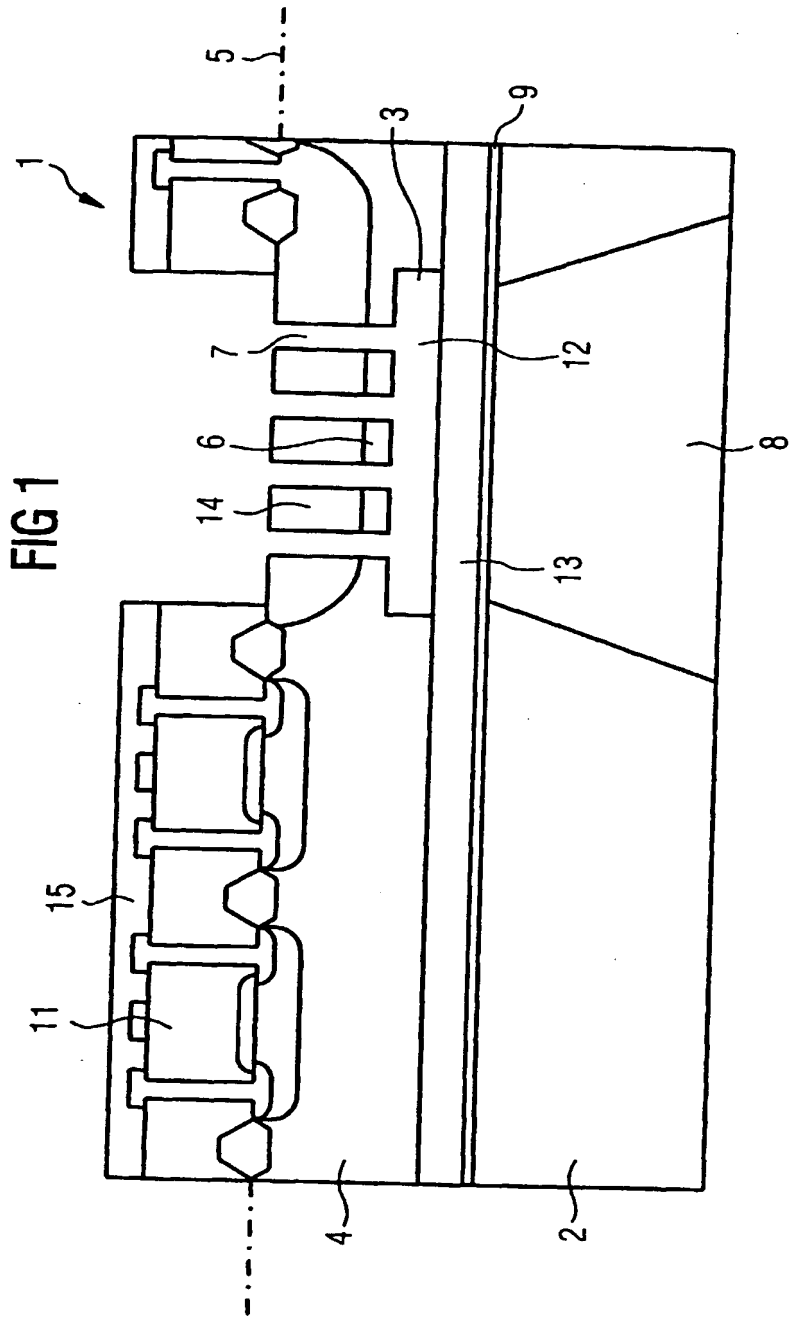
7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
 nach Schritt a) eine Seed-Schicht auf die Opferschicht aufgebracht wird, die beim Wachstum der ebenen Schicht, die in Schritt b) hergestellt wird, für verbesserte Wachstumsbedingungen sorgt. 35

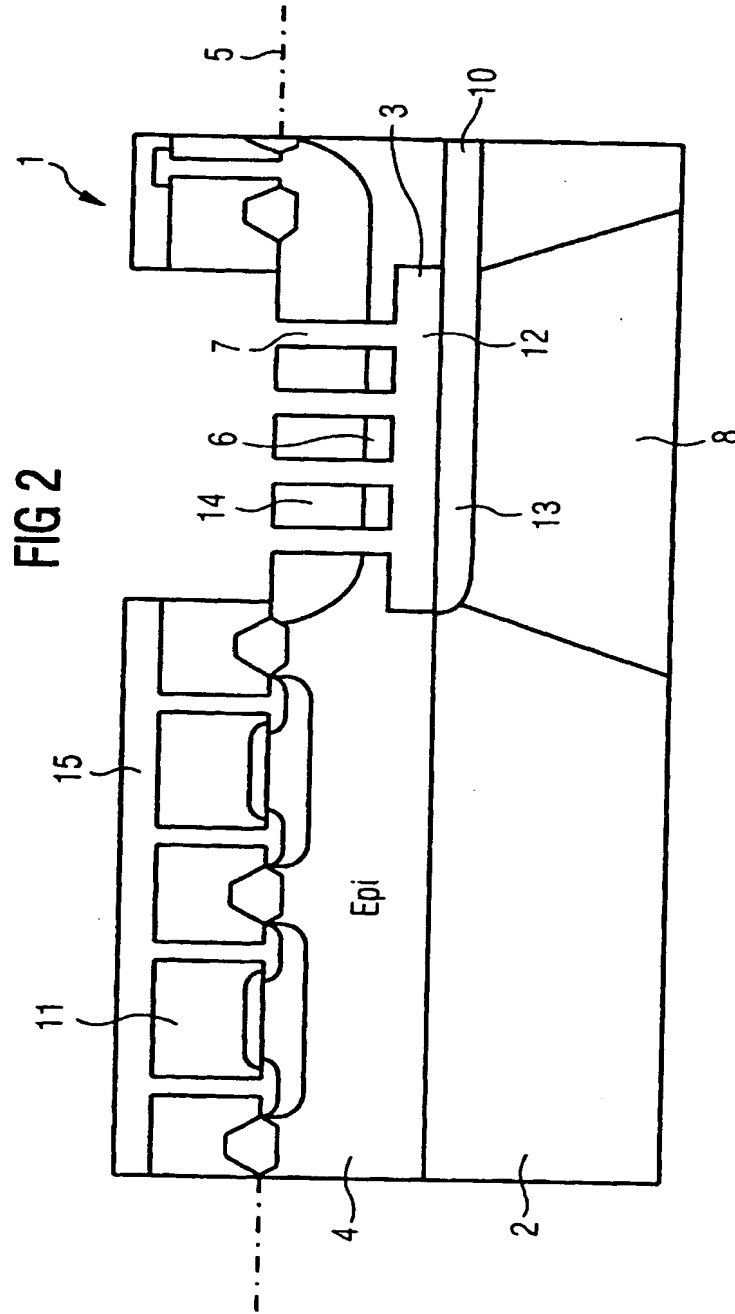
8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß
 die Rückseitenätzung in Abhängigkeit von der verwendeten Schicht für den Ätzstopp entweder stromlos oder elektrochemisch naßgeätzt wird. 40 45

9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß
 die Opferschicht und das Füllmaterial, welches sich in den Öffnungen (7) befindet, Siliziumoxid ist. 50

10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß
 nach Schritt d) vor Schritt e) ein an sich bekanntes Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Halbleiterschaltung durchgeführt wird. 55

11. Verwendung des mikromechanischen Sensors nach Anspruch 1 als Mikrofon oder Drucksensor.







Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 11 2978

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D,A	DE 196 48 424 C (SIEMENS AG) 25. Juni 1998 (1998-06-25) * das ganze Dokument *	1-11	601L9/00
A	US 5 677 560 A (ZIMMER GUENTHER ET AL) 14. Oktober 1997 (1997-10-14) * das ganze Dokument *	1,4	
A	DE 43 18 466 A (BOSCH GMBH ROBERT) 8. Dezember 1994 (1994-12-08) * Zusammenfassung; Abbildungen 1A-1D *	1,4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			601L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 8. November 1999	Prüfer Zafiropoulos, N
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.92 (P04003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 2978

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

08-11-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19648424 C	25-06-1998	WO 9823934 A	04-06-1998
		EP 0939888 A	08-09-1999
US 5677560 A	14-10-1997	DE 4017265 A	05-12-1991
		AT 126349 T	15-08-1995
		WO 9119177 A	12-12-1991
		DE 59106229 D	14-09-1995
		EP 0531347 A	17-03-1993
		JP 5509397 T	22-12-1993
DE 4318466 A	08-12-1994	FR 2707043 A	30-12-1994
		JP 7099326 A	11-04-1995
		US 5616514 A	01-04-1997

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82